課題番号 :F-18-TU-0132

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) :BN 膜を用いた RF-MEMS スイッチの作製

Program Title(English) : Fabrication of BN thin film contact RF-MEMS Switch

利用者名(日本語) :<u>松田崇行</u>¹⁾
Username(English) :<u>T. Matsuda</u>¹⁾

所属名(日本語) :1) 鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科, 工学専攻情報エレクトロニクスコース,

マイクロデバイス工学研究室

Affiliation(English) :1) Micro device engineering laboratory, Department of Engineering, Graduate

School of Sustainability Science, Tottori University

キーワード/Keyword:BN、スパッタ、膜加工・エッチング

1. 概要(Summary)

BN 膜を RF-MEMS スイッチに用いることで、ホットスイッチング時における動作回数向上が期待される。そこで東北大学西澤潤一記念研究センターの施設を利用して、BN 膜を用いた RF-MEMS スイッチの作製を試みた。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】 アルバック ICP-RIE

【実験方法】

- (i) BN 接点作製
- (ii) 下地層回路作製
- (iii) Ti 抵抗線作製
- (iv) Ni 犠牲層作製
- (v) Ni 犠牲層ディンプル作製
- (vi) Au めっき層作製
- (vii) Ni 犠牲層除去
- (viii) 洗浄·IPA 置換。超臨界乾燥

3. 結果と考察(Results and Discussion)

(i) BN 接点作製の洗浄工程において、BN 膜が剥離したため、デバイス作製を中止した。そのサンプルを Fig. 1 に示す

4. その他・特記事項(Others)

共同研究者

- ・ローム株式会社 奥良彰様
- •神港精機 野間正男様
- ・兵庫県立工業技術センター 山下満様
- •大阪大学産業科学研究所 長谷川敏彦様
- •京都大学工学研究科 占部継一郎様, 江利口浩二様

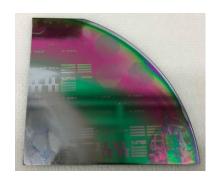


Fig. 1 Pictures of exfoliated BN film in the cleaning process.

参考文献

[1] M. Noma et al.: Jpn. J. Appl. Phys. **53**, 03DB02 (2014).

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし